

## 産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

バージョン推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2011年 8月公開分(49件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2011-147378	ジヒドロキシアセトンの製造方法	国立大学法人山口大学 独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2011-147501	穿刺針刺入装置	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2011-147857	自己組織化多層膜形成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2011-147870	海洋生物の付着を抑制する方法およびシステム、および、海洋生物の遊泳を阻害する方法	中国電力株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2011-148735	遺伝子	株式会社J-オイルミルズ 国立大学法人静岡大学 独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2011-149700	酵素免疫フロースルー検出法	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2011-149782	パーティクルフィルタリングによる移動ロボットからの2次元音源地図作成方法	関西電力株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2011-149828	振動検出システム、該システムを用いた装置及び振動検出方法	独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2011-149943	生体骨若しくは模擬骨又はそれらに装着する部材の応力分布測定方法及び測定部材	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2011-150297	導波路型光ゲートスイッチ	学校法人慶應義塾 独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2011-151228	酸化膜形成方法	株式会社明電舎 独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2011-151558	高音圧領域形成方法	関西電力株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2011-151559	高音圧領域形成方法	関西電力株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2011-152194	生体状態解析システム	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2011-152770	微細構造形成のための金型用離型膜およびそれを用いた金型	伊藤光学工業株式会社 東海精密工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2011-154210	波長ドメイン光スイッチ	日立電線株式会社 学校法人慶應義塾 独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2011-155929	マリナーゴールドの形質転換方法	株式会社小泉 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
18	特開2011-156209	動脈特性検出方法及び動脈特性検査装置	独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2011-156536	洗浄システムおよび洗浄方法	ダイダン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2011-157271	凝集体、及びその製造方法	三信鉱工株式会社 日本メナード化粧品株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2011-157314	有機フッ素化合物の分解方法	独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2011-157523	透明ハイガスバリア膜用コーティング液及びそれを用いて得られるコーティング膜並びに積層フィルム	大和製罐株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2011-157807	解体方法	鹿島建設株式会社 カヤク・ジャパン株式会社 株式会社構造安全研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2011-158368	複合表面粗さ標準片	株式会社小坂研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2011-158369	バイオチップ、抗原抗体反応検出用キット、及び抗原抗体反応の検出方法	国立大学法人東北大学 独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2011-158458	周波数可変直角相ブリッジ	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2011-158898	保護層により封止した全固体型反射調光エレクトロクロミック素子及びそれを用いた調光部材	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2011-159405	電界電子放出素子及びその製造方法	日産自動車株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2011-159453	酸化物超電導薄膜の製造方法	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
30	特開2011-161407	陽イオン金属または陽イオン化合物の分離方法及装置	パナソニック環境エンジニアリング株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2011-161408	細菌の繁殖抑制方法及装置	パナソニック環境エンジニアリング株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
32	特開2011-161409	純水製造装置	パナソニック環境エンジニアリング株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
33	特開2011-161835	リグノセルロース系充填材の製造方法、その方法を用いて製造したリグノセルロース系充填材、そのリグノセルロース系充填材を用いたリグノセルロース・熱可塑性樹脂複合材料及びそのリグノセルロース・熱可塑性樹脂複合材料を用いた成形体	奈良県 独立行政法人産業技術総合研究所
34	特開2011-162464	スルフィン酸塩化合物の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2011-162465	ベンゾイソチアゾリノン-1-オキシド化合物の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
36	特開2011-162478	ETBEの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2011-162481	重酸素化されたカルボニル化合物の製造方法	大陽日酸株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2011-162485	光学活性リン化合物の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2011-162503	含パラジウム化合物、その製造方法及びこれを用いる有機化合物の製造法	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2011-162727	Y型のチタニルフタロシアニンの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2011-162837	金属ナノ粒子クラスター、金属ナノ粒子クラスターを用いた標識材料、金属ナノ粒子クラスターを用いたイムノクロマトグラフィーキット、金属ナノ粒子クラスターの製造方法、金属ナノ粒子クラスターを用いた標識材料の製造方法および金属ナノ粒子クラスターを用いたイムノクロマトグラフィーキットの製造方法。	株式会社新光化学工業所 独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2011-163786	導波モードセンサおよびこれを用いた標的物質の検出方法	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2011-164537	ディスプレイ装置	株式会社ファインラバー研究所 マイクロプレジジョン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2011-164902	遡源証明可能な時刻統一方式	独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2011-165461	リチウムイオン二次電池正極材料	日本電気硝子株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2011-165501	リチウムイオン二次電池用熱暴走抑制剤及びリチウムイオン二次電池	日本バイリーン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2011-165941	半導体装置および半導体装置の製造方法	株式会社東芝 独立行政法人産業技術総合研究所
48	WO2009/128301	ダイヤモンド半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
49	WO2009/128349	カーボンナノチューブ配向集合体の製造装置及び製造方法	日本ゼオン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所